



Máster Universitario en
Ingeniería de
Telecomunicación

Atomic Layer Deposition, in Tartu, Estonia

18/03/2025

Ponente: Dr. Kristjan Kalam, Institute of Physics,
University of Tartu (Estonia)

Título: "Atomic Layer Deposition, in Tartu,
Estonia"

Idioma: Inglés

Fecha: Viernes 28 de marzo de 2025, 15:30 h.
(Aula 0.5, ETSIIT)

Resumen: El Laboratorio de Tecnología de Películas Delgadas de la Universidad de Tartu es pionero a nivel mundial en la fabricación de materiales novedosos de interés en la industria de los dispositivos electrónicos y circuitos integrados, mediante la utilización de la técnica Atomic Layer Deposition (ALD). En los últimos años esta técnica ha demostrado su aplicación en los dispositivos denominados Memristores, cuyas características para el almacenamiento no volátil, así como para replicar la plasticidad neuronal necesaria para el aprendizaje, los convierten en candidatos idóneos para la realización de sistemas hardware en el campo de la inteligencia artificial. En su disertación ante los estudiantes del Máster, el Dr. Kalam contextualizará el uso y aplicaciones de esta técnica en el Instituto de Física de la Universidad de Tartu, en el que desarrolla su tarea investigadora.

